

7.8 特許

2003 年度

1. 桑原裕司, 青野正和: 金属原子・金属クラスターによる量子メカニカルスイッチング方法と装置, 特願 2003-275754
2. 齋藤彰, 吉岡伸也, 木下修一: 発色体とその製造方法, 特願 2003-391572
3. 山内和人, 佐野泰久: 触媒支援型化学加工方法, 特願 2004-299263

2004 年度

1. 齋藤彰, 松本秀雄, 大西秀治, 青野正和: ニオブ酸リチウム基盤およびその製造方法, 特願 2004-101707
2. 齋藤彰: フローサイトメーター, 特願 2004-207518
3. 齋藤彰, 青野正和, 桑原裕司, 丸山淳平, 真鍋賢: 走査型プローブ顕微鏡システム, 特願 2005-90396
4. 齋藤彰, 青野正和, 大西秀治, 武尾篤, 松本英雄: タンタル酸リチウム基盤およびその製造方法ならびにタンタル酸リチウム基盤の表面処理方法, 特願 2005-090360
5. 遠藤勝義: 超純水プラズマ泡による超精密加工方法および装置, 特願 2005-348734
6. 森勇藏, 山村和也, 佐野泰久: 誘電体基板のパターン転写加工方法, 特願 2004-360939, 特開 2006-173225

2005 年度

1. 大参宏昌, 安武潔, 垣内弘章, 渡部平司: エピタキシャル Si 膜の製造方法およびプラズマ処理装置, 特願 2005-319273
2. 垣内弘章, 大参宏昌, 安武潔: Si 基板表面の炭化による結晶性 SiC の形成方法及び結晶性 SiC 基板, 特願 2005-329318
3. 大参宏昌: 大気圧水素プラズマを用いた膜製造方法及び装置, 特願 2005-311934
4. 片岡俊彦, 山内良昭: 光プローブ, 特願 2005-232565
5. 齋藤彰: 表示装置およびその製造方法, 特願 2006-47529
6. 山内和人, 三村秀和: 超精密形状測定法, 特願 2006-042547
7. 遠藤勝義, 後藤英和: 超純水プラズマ泡による超精密加工方法および装置, 特願 2005-348734
8. 後藤英和: 基板表面の加工方法, 特願 2006-005121
9. 遠藤勝義, 篠原亘: 酸化シリコンの製造装置および製造方法, 特願 2006-051631
10. 遠藤勝義: 位相ロックイン型高周波走査トンネル顕微鏡, 特願 2006-061421
11. 山村和也: 表面加工方法及び装置, 特願 2006-014564, 特開 2007-200954

2006 年度

1. 垣内弘章, 安武潔, 大参宏昌: Si 基板表面の炭化による結晶性 SiC の形成方法及び結晶性 SiC 基板, PCT/JP2006/322656
2. 大参宏昌, 安武潔, 垣内弘章: 大気圧水素プラズマを用いた膜製造法, 精製膜製造方法及び装置, PCT/JP2006/317817
3. 大参宏昌, 安武潔, 垣内弘章: プラズマ表面処理装置, 特願 2006-320517
4. K. Arima: Sample Observation Method and Observation Device, 11/509077
5. 片岡俊彦, 山内良昭: 光プローブ, 特願 2006-048503
6. 片岡俊彦, 山内良昭: 光プローブ, PCT/JP2006/315723
7. 山内和人, 久保田章亀, 八木圭太: 触媒支援型化学加工方法, 特願 2006-110200
8. 山内和人, 三村秀和, 岡田浩巳: X 線ミラーの高精度姿勢制御法, 特願 2006-221714
9. 佐野泰久: 精密加工方法及び精密加工装置, 特願 2006-183491
10. 山内和人, 佐野泰久, 原英之, 村田順二, 八木圭太: 触媒支援型化学加工方法及び装置, 特願 2006-221715
11. 三村秀和, 山内和人, 岡田浩巳: 電鍍法による超精密部品の製造方法及び超精密光学部品, 特願 2006-279269
12. 山内和人, 佐野泰久, 原英之, 村田順二, 八木圭太: 触媒支援型化学加工方法及び装置, 特願 2006-283781
13. 山内和人, 三村秀和, 岡田浩巳: X 線波面計測法と形状可変ミラーによる X 線集光法, 特願 2006-357566
14. 山内和人, 佐野泰久, 原英之, 村田順二, 八木圭太: 触媒支援型化学加工方法及び装置(1), 特願 2006-328331
15. 山内和人, 佐野泰久, 原英之, 村田順二, 八木圭太: 触媒支援型化学加工方法及び装置(2), 特願 2006-328287
16. 山内和人, 佐野泰久, 村田順二, 原英之, 八木圭太: 触媒支援型化学加工方法及び装置(3), 特願 2006-328515
17. 山内和人, 三村秀和: 超精密形状測定法, PCT/JP2007/052729
18. 広瀬喜久治, 後藤英和: 時間依存シュレディンガー方程式の数値シミュレーション装置, 特願 2006-247367

2007 年度

1. 大参宏昌, 安武潔, 垣内弘章: プラズマ処理装置及びプラズマ処理方法, ガス発生装置及びガス発生方法, 並びに, フッ素含有高分子廃棄物処理方法, 特願 2007-009637
2. 中野元博, 片岡俊彦: レーザプラズマ光源, 特願 2007-213321

3. 山内和人, 石川哲也, 大橋治彦, 津村尚史: 超精密形状計測方法及びその装置, 特願 2007-163132
4. 佐野泰久: プラズマ処理装置, 特願 2007-210131
5. 佐野泰久, 山村和也, 原英之, 加藤武寛: 半導体ウエハ外周部の加工方法及びその装置, 特願 2007-207866